PIENU実験

~π→ev崩壞分岐比測定実験~

•πev崩壊分岐比について
 •PIENU実験について
 •ビームテスト@TRIUMF
 ビームbackground
 ビームライン
 •まとめと今後

2007/12/25 年末発表会 久野研 D1 山田薫

π+→e+ve崩壞分岐比



 ヘリシティ抑制により、π→eは抑制される
 R = $\frac{\pi^+ \to e^+ \nu_e}{\pi^+ \to \mu^+ \nu_\mu} = \frac{g_e^2}{g_\mu^2} \frac{m_e^2}{m_\mu^2} \left(\frac{m_\pi^2 - m_e^2}{m_\pi^2 - m_\mu^2} \right)^2 \sim 10^{-4}$ •Wのレプトンへの結合定数は世代によらない
 Ge=Gµ 電子-ミューオン普遍性

現在の測定値

RSM=1.2353±0.0004 × 10⁻⁴ (精度:0.03%)

● TRIUMF(E248) R^{exp}=1.2265±0.0034(stat)±0.0044(sys) × 10⁻⁴(1992) 精度:0.5%

● PSI R^{exp}=1.2346±0.0035(stat)±0.0036(sys) × 10⁻⁴(1993) 精度:0.4%

感度を持つNew Physics

Non universality

g_{e≠}gµ SU(2)xSU(2)xSU(2)xU(1)

<u>新しい擬スカラー相互作用</u> ヘリシティ抑制の 効かない相互作用に敏感 Charged Higgs など

<u>その他</u>

Massive neutrino R-parity violating SUSY

<u>PIENU</u>実験の目標

分岐比Rを0.1%以下の精度で測定、擬スカラーのマススケール<1000TeV

TRIUMF E248:前実験 (~1992)



R^{exp}=1.2265±0.0034(stat)±0.0044(sys) × 10⁻⁴ 精度:0.5%(0.28%,0.36%)

問題点

陽電子アクセプタンス(立体角)が小さい (~2%)

NaIの低エネルギーテールの補正の誤差がおおきい(0.3%)

TRIUMF E248:前実験 (~1992)



R^{exp}=1.2265±0.0034(stat)±0.0044(sys) × 10⁻⁴ 精度:0.5%(0.28%,0.36%)

問題点

陽電子アクセプタンス(立体角)が小さい (~2%)

NaIの低エネルギーテールの補正の誤差がおおきい(0.3%)

PIENU実験@TRIUMF (2008~)

目標精度:0.1%(現在の1/5)以下 TRIUMF M13ビームライン パイオンビーム:73±1%MeV/c 検出器

●ビーム軸上にNaI カロリメーター
(+)立体角10倍
(-)シャワーリーク増大、ビームBGの増加

●CsIのリング

●シャワーリークの検出

●シリコン検出器

入射、放出粒子トラッキング ●500MHz FADC読み出し



<u>改善点</u>

統計30倍:立体角10倍(25%) Runタイム3倍以上 系統誤差1/5:テール補正の誤差1/10(FADCデータの波形解析、トラッキング)

PIENU Detactor









ビームテスト@TRIUMF、M9Aビームライン,2006/12

目的

- ●500MHz FADCシステムのテスト
- ●ターゲット信号の波形解析
- ●テール補正のstudy
- ビーム軸上にNaIを置いたことによるBGのstudy

ビーム

73MeV/c π:μ:e=3:2:5 ~80kHz

<u>セットアップ</u> シンチレータとNalのみ、PMT読み出し

Csl、Wire Chamber、Silicon Strip は無し





統計数の見積り

事象選択

- ●パイルアップ除去
- ●エネルギー損失,TOFによるπ+選択
- ●突抜け事象の除去
- ●プリパイルアップ除去
 - トリガー前6.6usの間にμ、πがある事象を除去
 - (FADCのGATEは7.8us)



π→e事象 46k/60h (前実験:200k)

<u>前実験の30倍の統計→約320日</u>

ビームライン改善によるビーム陽電子の減少:1/10

パイオンレートの増加:2倍

DAQの改善

->2倍ほどの改善が期待

Beam background

Background(1)



beam-e inefficiency background ビーム軸上にNaIを置いたことによるBG 分布は理解できるので許容できそう pileup background 前実験と同程度 1/10程度に減らしたい

Pileup background 中性粒子によるpileupが支配的(~73%)





Background(2) 中性粒子

Plastic Scintillatorsにhitなしかつ NaI hit ->11.3kHz



beam中に中性粒子が含まれている

最終コリメーターに当たったeがγを作り出していると考えられる ビームラインの改善が必要 ポジトロンを減らすー>ごみデータの減少、beam-eBGの減少 中性粒子を減らすー>pileup BGの減少





電子削減のテスト@M9ビームライン







e:37, μ:16,π:25 kHz(degraderなし Dec06) e:10,μ:26,π:60 kHz(degrader有り Aug07) π/eは10倍改善

陽電子<mark>1/10</mark>の削減に成功



検出器の製作、テスト •~2008/3 サポート Wire Chamber CsIリング シリコン検出器 エンジニアリングラン •2008/4~6 物理データ取得開始 •2008/8~

まとめ

- 分岐比**R=Γ(**π→e) /Γ(π→μ→e) を0.1%以下の精度で測定することを 目指したPIENU実験を準備中であり、2008年8月から物理測定を開始 する予定である。
- ●ビームテストを行い基礎的な解析をおこなった。
 ●半年から一年で前実験の30倍の統計が期待。
 - ●ビーム直下にNalをおいたことによる致命的なBGはみられなかった。
 - ●ビームラインの改善によりパイルアップによるBGは前実験の1/10 程度になると期待できる
- 現在検出器を製作中。

Backup slide



テール補正(1):ターゲットカット NaIカロリメーターで測定した $\pi \rightarrow e(69.3 \text{ MeV})$ の低エネルギーテールを見積る カロリメーターの応答関数のテール(シャワーリーク) \bullet ターゲットの情報で π -µ-eのµを識別し、 π -µ-eをサプレスしたNaIスペクトルを作成

エネルギー損失:+4MeV

波形解析:3パルス









●ターゲットの情報で**п-µ-eのµ**を識別し、**п-µ-e**をサプレスしたNaIスペクトルを作成





-µ-eBG 2種類に分別できる Decay-at-rest Decay-in-flight

テール補正(2)



Þ実験での期待値 π-eテール:CsIリングにより 24<mark>%->2%</mark> π-μ-e BG :シリコン検出器によるトラッキング 27%->3%

Tail with Csl





DIF事象のターゲットでのエネルギー損失(MC)



トラッキングによるDIFカットの評価

Monte Carloによる評価
DIF事象によるバックグラウンド:22%
ターゲットの上流で崩壊(DIF-us):19%
ターゲット中で止まる前に崩壊(DIF-it):3%

トラッキングによるDIF事象の識別
 4層のシリコン検出器による入射、放出粒子
 のトラッキングによりDIFを識別
 入射粒子の角度 : DIF-us
 崩壊点再構成(再近接距離、崩壊点): DIF-us DIF-it





これらにより1/10程度のサプレッションが期待 現在、より現実的なMCにより評価中

トラッキングによるDIFカットの評価2





Pulse shape cut(2)

Define probability from each variable

Then define likelihood from them

Likelihood $P = p_{\chi^2} \times p_{\Delta T_{\pi}} \times p_{\Delta T_{e}}$ $L_{\pi e} = P(1 - lnP + \frac{1}{2}(lnP)^2)$





Pulse shape cut L_{pie} > 0.1 pie acceptance 91% pimue suppression 8.36±0.07% ~1/10

This corresponds to identify double pulses ΔT >1.2ns

波形解析とdecay-in-flight事象

波形解析カットとターゲットエネルギー



波形解析カットの効きが悪い

ビームπのdecay-in-flight(DIF)事象が支配的







期待される誤差のまとめ

【 <u>アクセプタンス補正誤差目標</u> :0.11%−>0.03% MCの改善、立体角の増加、物質量の減少 測定データの改善(PDG)	
統計誤差	0.05%(0.28)
Raw Branching Ratio	0.03%(0.19%)
テール補正	0.03%(0.25%)
アクセプタンス補正	0.03%(0.11%)
パイオン寿命	0.03%(0.11%)
その他	0.03%(0.11%)
全系統誤差	0.07%(0.31%)
全誤差	0.08%(0.5%)
	()は前実験

0.1%以下の精度での測定を目指す!

Dominant Errors

Previous experiment

TABLE I. $\pi \rightarrow e\nu$ branching ratio summary.

Raw branching ratio $R' (\times 10^{-4})$	$1.1994 \pm 0.0034 ({ m stat}) \pm 0.0023 ({ m sys})$
Multiplicative corrections	
Tail correction	1.0193 ± 0.0025
Pion stop time t_0	0.9998 ± 0.0008
Time calibration	1.0000 ± 0.0003
Monte Carlo	1.0027 ± 0.0011
V1 veto	1.0009 ± 0.0005
Wire-chamber inefficiency	0.9998 ± 0.0004
π lifetime	1.0000 ± 0.0009
Branching ratio R_{expt} (×10 ⁻⁴)	$1.2265 \pm 0.0034({ m stat}) \pm 0.0044({ m sys})$

There were 3 kind of dominant errors

Discussion about periodic BG

Before TINA pileup cut

Timing defined by e+ in T2 ADC GATE is ~100ns

flat(mu life time) nutral particle periodic 43ns

Timing distribution in T2.

After TINA pileup cut

e+ from pimue

flat(mu life time) nutral particle

periodic 43ns Timing distribution in T2



Set up

4 Silicon strip detectors are put in Other counter sizes is not changed, only shift z position of the B1&B2 (-3mm) and T1&T2 (+3mm)



Pencil beam 70±1%MeV Target size 5x5x12 mm

Silicon Thickness : 570 um (285umx2) Distance : 5 mm Position resolution: 100 um

energy resolution 40p.e./MeV=5%@10MeV

N=Npie/Sqrt(Npimu-tail) S=Npimu-tail/Npie

